

## メインクリーンルーム Main clean room (1F clean room)

Last update 2017/4/17

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
パイロ酸化炉 (Thermal oxidation furnace)	Sugawara(T.Tanaka Lab:D)	6909	Shima(T.Tanaka Lab:M)	6909		
水素アニール炉 (H2 anneal furnace)	Harashima (T.Tanaka Lab:D)	6909	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909		
AIエッチャー (Al etcher)	Shima(T.Tanaka Lab:M)	6909	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909		
STS ICP RIE#1	Tanikawa (T.Tanaka Lab:D)	6909	Sugawara(T.Tanaka Lab:D)	6909		
STS ICP RIE#2	Watanabe (Technical Division)	6256	Hokama (Ono Lab:M)	5810		
ANELVA RIE#1	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909	Zhao (Ono Lab:M)	5810	Asano (S.Tanaka Lab:D)	6937
ANELVA RIE#2	Kojima (Technical Division)	6256				
FAB	Tomoki shimizu (Hane Lab:M)	6965				
イオン注入装置 (Ion implantation)	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909		
P-TEOS CVD	Kojima (Technical Division)	6256	Watanabe (Technical Division)	6256		
EVGボンダ (EVG Bonder)	Kojima (Technical Division)	6256				
YOUTECプラズマCVD (YOUTEC P-CVD)	Tanikawa (T.Tanaka Lab:D)	6909	Shima(T.Tanaka Lab:M)	6909		
プラズマSiN-CVD (P-SiN-CVD)	Harashima (T.Tanaka Lab:D)	6909	Shima(T.Tanaka Lab:M)	6909		
TEL LPCVD	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909	Harashima (T.Tanaka Lab:D)	6909		
DFR CONTACT ETCHER	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909		
エリプソメーター(CR) (ellipsometer)	Harashima (T.Tanaka Lab:D)	6909	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909		
接触式段差計 (Surface profiler)	Wakebe (T.Tanaka Lab:D)	6909	Shima(T.Tanaka Lab:M)	6909		
UV照射器 (UV exposure)	Wakebe (T.Tanaka Lab:D)	6909	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909		
UHV-CVD	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909				
RTA#1	Sugawara(T.Tanaka Lab:D)	6909	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909		
SiNエッチャー (SiN etcher)	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909				
O2アッシャー (O2 usher)	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909	Sugawara(T.Tanaka Lab:D)	6909		
微細電極形成装置 (Electrode etcher)	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909				
SiCN Cat-CVD	Toda (Ono Lab:Assoc.Prof)	5810				
イオンビームミリング装置 (ion beam milling)	Liu (S.Tanaka Lab:D)	6937				
ICP RIE ペガサスA (Pegasus Advanced)	Ezura (Ono Lab:M)	5810				
超臨界CO2乾燥装置 (supercritical CO2 drier)	Imran (Ono Lab:D)	5810				

## 金属蒸着室 Metal Deposition room (1F clean room)

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
ANELVA Sputter	Endo (Saka Lab:M)	6898	Nakakura (Saka Lab:M)	6898	Kohiyama (Yugami Lab:D)	6925
EIKO Sputter	Morimura (S.Tanaka Lab:M)	4771				
DC対向ターゲットスパッタ (Facing target DC sputter)	Li (Ono Lab :D)	6937				
RF対向ターゲットスパッタ(大阪真空) (Facing target RF sputter)	Tanaka (S.Tanaka Lab:Professor)	6937				
EB蒸着 (EB evaporation)	Kaneko (S.Tanaka Lab:D)	6937	Nakazawa (Hane Lab:D)	6965		
RFスパッタ(AIスパッタ) (Al target RF sputter)	Sugawara(T.Tanaka Lab:D)	6909	Shima(T.Tanaka Lab:M)	6909		
SHIBAURA Sputter#1	Matsuura (Yugami Lab:M)	6925	Watanabe (Technical Division)	6256		
SHIBAURA Sputter#2	Zhu (Ono Lab:D)	5810				
ECR Sputter	Sakurai (S.Tanaka Lab:M)	6937				
4探針測定器 (Four-point probe resistivity measurement)	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909	Shima (T.Tanaka Lab:M)	6256		
先端融合ウエハボンダ (Wafer bonder)	Teranishi (S.Tanaka Lab:M)	6937		6937		

## イエロールーム Yellow room (1F clean room)

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
レーザー描画装置 (Laser mask writer)	Harashima (T.Tanaka Lab:D)	6909	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909	Kojima (Technical Division)	6256
EVGアライナー (EVG aligner)	Kojima (Technical Division)	6256	Morikawa (T.Tanaka Lab:M)	6909		
EVG接合用基板洗浄 (EVG megasonic cleaner)	Watanabe (Technical Division)	6256				
EVGプラズマ表面活性化装置 (EVG plasma activator)	Watanabe (Technical Division)	6256				
2流体洗浄装置 (Two-fluid cleaner)	Yunoki (S.Tanaka Lab:Resercher)	6937				
ミカサ片面アライナー (Mikasa aligner)	Sakamoto (Technical Division)	6256				
HMDS処理装置 (HMDS treatment system)	Sakamoto (Technical Division)	6256				

## 暗室 Dark room (1F clean room)

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
JEOL-EB	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909				
JEOL-SEM	Kino (T.Tanaka lab:Assist.Prof.)	6909				

## レーザー加工室 Laser fab. Room 2F

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
YAGレーザー (YAG laser)	Imran (Ono Lab:D)	5810				
薄膜評価装置 (Thin film characterization system)	Kojima (Technical Division)	6256				
パレリン蒸着 (Polylene evaporator)	Shao (S.Tanaka Lab:D)	6937	Tsuruoka (Haga Lab:Assist.Prof)	5251		
MBE	Hane (Hane Lab:Professor)	6965				
ホール効果測定装置 (Hall effect measure)	Sasaki (Hane Lab:Assist. Prof)	6965				
PL測定装置 (PL measurement)	Hirano (S.Tanaka Lab:Assist. Prof.)	6937				
PLD	Hasegawa (S.Tanaka Lab:M)	6937	Thao (S.Tanaka Lab:M)	6937		

## 分析室 Analysis room 2F

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
FE-SEM	Watanabe (Technical Division)	6256	Kohiyama (Yugami Lab:D)	6925	Kojima (Technical Division)	6256
熱電子SEM (thermal electron SEM)	Toda (Ono Lab:Assoc.Prof)	5810				
FIB	Kojima (Technical Division)	6256	Fukaya (Saka Lab:M)	6898		
SIMS	Kojima (Technical Division)	6256				
蛍光X線膜厚計 (X-ray fluorescence thickness monitor)	Kojima (Technical Division)	6256				
マルチターゲットスパッタ (Multi-target sputter)	Toan (Ono Lab:Assist.Prof)	5810				
急冷機構付真空加熱装置 (lapid cooling vacuum heater)	Matsunaga (Haga Lab:Assist,Prof)	5251				

## 光学測定室 Optical meas. Room 2F

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
紫外分光エリプソメーター (Vis.-IR spectroscopic Ellipsometer)	Kojima (Technical Division)	6256				
XeF2エッチャー (XeF2 gas etcher)	Ito (Haga Lab:Resercher)	5251	Nguyen (S.Tanaka Lab:Resercher)	6937		
光パラメトリック発信器 (optical parametric oscillator)	Sasaki (Hane Lab:Assist. Prof)	6965				
マルチチャンネル分光器 (multichannel spectrometer)	Sasaki (Hane Lab:Assist. Prof)	6965				
ASTeXプラズマCVD (Astex diamond CVD)	Li (Ono Lab:D)	5810				
赤外接合評価装置 (Wafer bonding inspector)	Kojima (Technical Division)	6256	Fukushi (Ono Lab:Resercher)	6256		
フェムト秒レーザー (Femtosecond laser)	Matsunaga (Haga Lab:Assist,Prof)	5251				
断面試料作製研磨装置 (Polish SEM Sample maker)	Watanabe (Technical Division)	6256	Kojima (Technical Division)	6256		
断面試料作製ミリング装置 (Ion milling SEM Sample maker)	Watanabe (Technical Division)	6256	Kojima (Technical Division)	6256		
圧縮引張試験機 (tension and compression fatigue tester)	Fromel (S.Tanaka Lab:Assoc.Prof)	6937				

### 組立評価室 Assembly test room 2F

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
めっきセット#1 (Electroplating setup#1)	Sakamoto (Technical Division)	6256				
めっきセット#2 (Electroplating setup#2)	Sakamoto (Technical Division)	6256				
ハイボスHIPOS (HIPOS)	Suwa (Ono Lab:M)	5810				
レーザードップラー振動計 (Laser Doppler vibrometer)	Suwa (Ono Lab:M)	5810				
紫外線露光装置 (UV exposure)	Watanabe (Technical Division)	6256				
屈折率測定装置 (Refractive index meter)	Sasaki (Hane Lab:Assist. Prof)	6965				
ワイヤボンダ (Wire bonder)	K.Tsukamoto (S.Tanaka Lab:Resercher)	6937				
14GHzネットワークアナライザ (14GHz network analyzer)	Kadota (S.Tanaka Lab:Professor)	6937				
プローバ (prober)	Ishikawa (S.Tanaka Lab:Reserch Assoc)	6256				
インピーダンスアナライザ (impedance analyzer)	Kawabata (Haga Lab:M)	5251	Yoshida (Haga Lab:M)	5251		
半導体パラメータアナライザ (Semiconductor parameter analyzer)	Muroyama (S.Tanaka Lab:Assoc.Prof)	6937	Miyaguchi (S.Tanaka Lab:Reserch Assoc.)	6937		
ウェハプローブステーション (Probing station)	Thao (S.Tanaka Lab:D)	6256				
LSIテスタ (LSI tester)	Muroyama (S.Tanaka Lab:Assoc.Prof)	6937	Miyaguchi (S.Tanaka Lab:Reserch Assoc.)	6937		
フリップチップボンダ #2 (flip chip bonder#2)	Asano (S.Tanaka Lab:D)	6937				

### 電気実験室 Electric experiment room 3F

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
基板加工装置 (Circuit board plotter)	Sun (S.Tanaka Lab:M)	6256				
旋盤 (lathe)	Kojima (Technical Division)	6256				
ボール盤 (drill press)	Kojima (Technical Division)	6256				
フライス盤 (milling machine)	Kojima (Technical Division)	6256				

### 3階実験室 3F experiment room

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
研磨装置 (Grinding machine)	Kojima (Technical Division)	6256				
ポリテック (Polytec microsystem analyzer)	Inomata (Ono Lab:Assist.Prof)	5810				
全真空顕微FTIR (FT-IR)	Kojima (Technical Division)	6256	Toda (Ono Lab:Assoc.Prof)	5810		
フリップチップボンダ (flip chip bonder)	Kohiyama (Yugami Lab:D)	6925				
研削装置 (Grinding machine)	Tsukamoto (S.Tanaka Lab:Assist.Prof)	6937				
ポリテック 高周波レーザードップラ計 (Polytec high-frequency laser Doppler me)	Hirano (S.Tanaka Lab:Assist.Prof)	6937				
紫外可視近赤外分光光度計 (UV/Vis./IR spectrometer)	Kojima (Technical Division)	6256				
レーザーダイサー (Laser dicer)	Kojima (Technical Division)	6256				
接合力評価装置 (Bonding force measurement system)	Liu (S.Tanaka Lab:D)	6937	Asano (S.Tanaka Lab:D)	6937		
インピーダンス/マテリアルアナライザ (impedance/material analyzer)	Kawabata (Haga Lab:M)	5251	Yoshida (Haga Lab:M)	5251		
新ワイヤボンダ (New wire bonder)	K.Tsukamoto (S.Tanaka Lab:Resercher)	6937	Hamza (S.Tanaka Lab:M)	6937	Miyaguchi (S.Tanaka Lab:Reserch Asso)	6937

## ナノマシニング棟 Nano machining building (clean room)

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
ESCA分析装置 (XPS)	Kojima (Technical Division)	6256				
走査型プローブ顕微鏡Olympus (Olympus SPM)	Yoshida (S.Tanaka Lab:Assoc.Prof)	6937				
走査型プローブ顕微鏡Shimazu (Shimadzu SPM)	Yoshida (S.Tanaka Lab:Assoc.Prof)	6937				
ホットフィラメントCVD (Hot-filament CVD)	S.Tanaka Lab	6937	Ono Lab	5810		
投影露光装置 (Ushio projection aligner)	Kojima (Technical Division)	6256				
PE-CVD[CNTs] (CNTs-PE-CVD)	An (Ono Lab:Resercher)	5810				
レーザードップラー振動計 (Laser Doppler vibrometer)	Ono Lab	5810				
レーザー描画装置 (Laser mask writer)	Kojima (Technical Division)	6256	Watanabe (Technical Division)	6256		
UHV-STM&AFM	Ono (Ono Lab:Professor)	5810	Yoshida (S.Tanaka Lab:Assoc.Prof)	6937		
簡易マスク作製装置 (Simple photo-mask maker)	Ishikawa (S.Tanaka Lab:Reserch Assoc)	6256				
パターンジェネレーター (Pattern generator)	Kojima (Technical Division)	6256				

## フロンティア棟 Frontier Building

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
ダイサー (dicer)	Sunada (Hane Lab:M)	6965				

## 量子 Quantum Building

装置名 Equipment	正担当者 Responsible person	内線Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線 Ext	副担当者 Assist. responsible person	内線Ext
全自動多目的X線回折装置 (XRD)	Kojima (Technical Division)	6256	Abe (Watanabe Lab:Assist.Prof)	7911	Nishizawa (S.Tanaka Lab:M)	6937